附件3：

2020年第一批半导体材料协会标准项目计划

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采标  情况 | 完成  时间 | 技术归口单位 | 主要起草单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源：《关于下达2019年第三批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]144号，2019年8月26日） | | | | | | | | | |
| 1 | 2019-0031-T/CNIA | 电子工业用高纯硫酸 | 推荐 | 制定 |  |  | 2020 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 苏州汉谱埃文材料科技有限公司 |
| 任务来源：《关于下达2020年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2020]8号，2020年1月20日） | | | | | | | | | |
| 2 | 2020-023-T/CNIA | 多晶硅生产用氢气中金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 2021 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 |
| 3 | 2020-024-T/CNIA | 氮化硅造粒粉 | 推荐 | 制定 |  |  | 2021 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 新疆晶硕新材料有限公司、新疆新特新能材料检测中心有限公司、浙江上硅聚力特材科技有限公司 |
| 4 | 2020-025-T/CNIA | 半导体材料痕量杂质分析用高纯可溶性聚四氟乙烯器皿 | 推荐 | 制定 |  |  | 2021 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、北京诚驿恒仪科技有限公司、苏州汉谱埃文材料科技有限公司、集萃新材料研发有限公司 |
| 5 | 2020-026-T/CNIA | 半导体硅材料行业用高纯丁腈手套 | 推荐 | 制定 |  |  | 2021 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司、江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、苏州利得尔网络科技有限公司 |